

WEB

# とっきよ

平成23年8月号 No.28

編集 特許庁総務課

平成23年7月27日発行

「とっきよ」は特許行政の動向に関して、ご理解と  
意思の疎通を図る目的で発行されるものです。



## 目次

第4回五大特許庁長官会合について . . . . .	国際課	1
申請要件を緩和した特許審査ハイウェイ . . . . . 「PPH MOTTAINAI」試行プログラムの開始について	国際課	4
産業財産権の現状と課題の公表について . . . . . ～グローバル化に対応した知的財産システムの強化～ 〈特許行政年次報告書2011年版〉	企画調査課	6
WIPOにおける意匠制度の手続調和に向けた動きについて . . . . .	意匠課	16
特許庁ニュース： 「子ども見学デー」の開催について . . . . .	総務課	20
産業財産権イベントカレンダー . . . . .		21

# 第4回五大特許庁長官会合について

## 国際課

### I. はじめに

経済のグローバル化に伴い、先進国において国際的に事業展開する企業が増加し、一つの発明を複数国に出願する傾向が強まっています。このため、審査の待ち期間の長期化や、各国特許庁における審査負担の増大といった課題が生じています。

そこで、全世界の特許出願件数の8割を占める日米欧中韓の五大特許庁（五庁）は、これらの課題を解決すべく、2007年より長官会合を開催し、審査の協力や特許手続の効率化に取り組んできました。

特許制度の国際的な調和が進むことで、日本で特許となった自社の発明が、海外でも特許となる可能性が高まるため、国際的に事業展開する企業は、自社の発明が世界中で保護されることで、安心して自社の製品、技術を輸出することができます。しかしながら、制度調和の議論は、各国の意見の対立によりここ数年停滞していたところ、今回の会合において日本のリーダーシップの下、議題として取り上げられました。

### II. 開催日、場所

2011年6月23日（木）～24日（金） 日本国特許庁・東京

### III. 参加者

海江田経済産業大臣

日本国特許庁（JPO）：岩井長官（今会合の議長） 他

欧州特許庁（EPO）：バティステリ長官 他

韓国特許庁（KIPO）：イ庁長 他

中国国家知識産権局（SIPO）：ティエン局長 他

米国特許商標庁（USPTO）：レア副長官 他

（オブザーバー）世界知的所有権機関（WIPO）：ガリ事務局長

### IV. 会合の結果

冒頭に海江田経済産業大臣から、研究開発の成果を迅速に特許権として保護することはイノベーション促進に不可欠であり、五大特許庁の協力はイノベーションを促進する上でとても重要であるとの挨拶がありました。

そして、我が国特許庁の提案により、本会合において初めて特許制度調和が五庁長官会合の議題となり、各庁の長官が今後の特許制度調和の進め方について活発に意見交換を行いました。この結果、五庁は、特許制度の国際調和の重要性を共有し、これに向け、特許権を付与することの各国の主権を尊重しつつ、五庁が積極的に国際的な議論に参画してい

くことに合意いたしました。また、五庁の枠組みのもとで各国の特許制度や審査実務の比較研究を早急に実施することも併せて合意されました。

この合意をきっかけに、特許制度の国際的な調和が進めば、日本で特許となった発明について、海外でも円滑に特許を取得できるようになり、権利保護される可能性が高まるので、日本の産業界は安心して国際的な事業展開や研究開発を行うことができるようになります。

折しも米国において、特許制度を先発明主義から先願主義\*<sup>1</sup>へと移行させる特許改革法案が3月に上院本会議を通過し、6月23日（現地時間）に下院本会議を通過しました。この下院での法案審議と本会合とが重なり、カッポス USPTO 長官は本会合へ参加できませんでしたが、法案の下院通過直後に東京とアメリカとを電話回線で結び、同長官から会合参加者に法案下院通過の報告がありました。この様な中、今後特許出願の急増が予想される中国を含む五庁が、特許制度を国際的に調和させることの重要性を確認し、国際的な議論に積極的に参画していくとの合意は、特許制度の調和に向けた長年の取組の中で、非常に意義深いものです。

また、会合では、我が国特許庁が推進している「特許審査ハイウェイ\*<sup>2</sup>」など、特許審査に関するワークシェアリングに、五庁が取り組むことの重要性や利益についても確認がなされました。

さらに、3つの作業部会から10の基礎プロジェクトに関する進捗報告が行われました。特に、“特許分類”を共通化するプロジェクトにおいては、我が国特許庁の特許分類と欧州特許庁の特許分類を軸に、五庁の間で共通の特許分類の整備を加速していくことが合意されました。

より緻密な共通の特許分類ができれば、世界の特許文献を効率的かつ網羅的に調査することができるので、特許権の安定性、信頼性が高まります。また、企業自身も、自社技術と関連する中国・韓国の特許などを容易に発見できるので、海外での知財訴訟のリスクに備えることができます。

## \* 1 先願主義と先発明主義

同じ発明が複数の人間によりなされた場合、そのいずれに特許を与えるかを決定する原則として、先願主義と先発明主義があります。先願主義は、先に出願した者に特許を付与する主義（米国以外が採用）であり、先発明主義は先に発明した者に特許を付与する主義（米国のみ採用）です。国際的な特許制度調和の議論のなかでは、先願主義を採用する動きが主流であったものの、米国において、先発明主義から先願主義へ移行する法案が長年議会を通らなかつたため、特許制度調和の障害となっていました。

## \* 2 特許審査ハイウェイ

ある国で特許権を取得することが可能と判断された出願について、出願人の申請により、別の国で簡易な手続で審査を早期に受けられるようにする制度です。



(写真) 左から、パテンス長官 (EPO)、イ庁長 (KIPO)、岩井長官 (JPO)、海江田大臣、レア副長官 (USPTO)、ティエン局長 (SIPO)、ガリ事務局長 (WIPO)

## V. おわりに

今後も、五庁が引き続き協力していくことで、各庁における特許審査の質を担保しつつ、効率を向上させるとともに、さらに、日本発の特許出願がグローバルに保護される環境をより一層整備してまいります。

<リンク>

**五大特許庁公式サイト**

<http://www.fiveipoffices.org/index.html>

# 申請要件を緩和した特許審査ハイウェイ 「PPH MOTTAINAI」試行プログラムの 開始について

調整課・国際課

## I. はじめに

企業等のグローバルな活動の拡大に伴って、国際的に事業展開する企業が増加し、一つの発明を複数国に出願する傾向が強まっています。そして、このように世界的に特許出願件数が急増する中、審査待ち期間も長期化しており、各国特許庁でそれぞれ行われる同一内容の発明の審査のような相互に重複する業務をできる限り低減する必要性が高まっています。このため、我が国は、一方の国で特許可能と判断された出願について、出願人の申請に基づき、他方の国でその審査結果を参照しながら早期審査を行う枠組みである「特許審査ハイウェイ（PPH）」を各国とともに進めているところです。

PPHにより、出願人の海外における特許権取得の早期化が促進されます。また、他庁の先行技術調査や審査結果を利用することで、各国特許庁の負担の軽減と特許の質の向上が図られます。

## II. 「PPH MOTTAINAI」試行プログラムの開始について

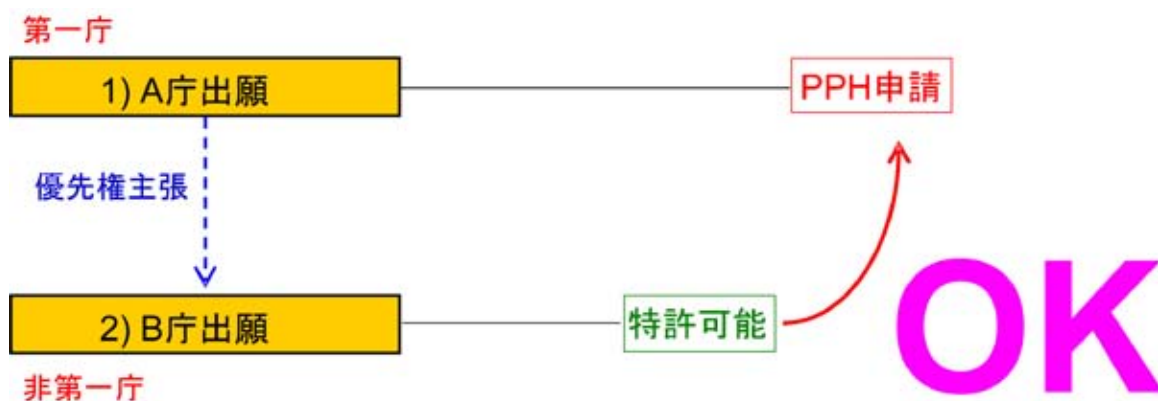
これまでのPPH申請要件では、PPH申請の基礎となる案件が、最初に出願を受理した第一庁において審査結果が出されているものに限られていました。しかしながら、実際には、必ずしも第一庁が他庁よりも先に審査結果を出しているわけではなく、その結果、ある庁において審査結果が出されているにもかかわらず、これを活用することができないという“モッタイナイ”状況がありました。我が国特許庁は、有益な審査結果を国際間でさらに活用させるべく、PPHプログラムの参加国と、PPH申請の要件緩和に向けて協議を重ねてまいりました。

このたび、我が国を含む8か国（日本、米国、英国、カナダ、オーストラリア、フィンランド、ロシア、スペイン）は、PPH申請の要件を緩和し、対象案件を拡大した「PPH MOTTAINAI」試行プログラムを本年7月15日より開始しました。我が国特許庁は、上記国々のうち、米国、英国、カナダ、フィンランド、ロシア及びスペインとの間で本試行プログラムを実施しております。なお、試行期間は1年間で、必要に応じて延長されます。

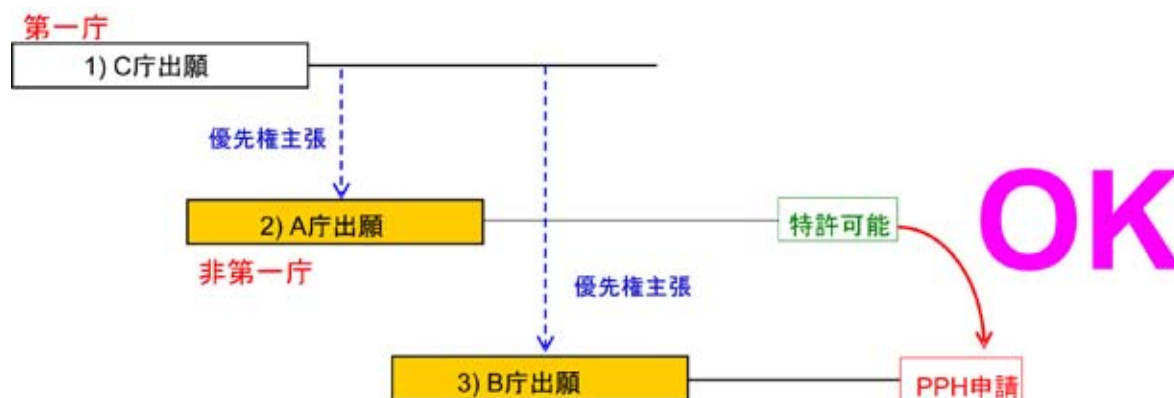
## III. 「PPH MOTTAINAI」試行プログラムのスキーム

「PPH MOTTAINAI」試行プログラムでは、どの国に先に特許出願をしたかにかかわらず、本試行プログラム参加国のいずれかの国による特許可能との審査結果があれば、当該いずれかの国と本試行プログラムを実施している国において、PPHの利用が可能となります。例えば、下記の事例1、2のような通常PPH申請が認められなかったケースも、本試行により新たにPPH申請が可能となります。

(事例1) B庁(非第一庁)の審査結果を用いてA庁(第一庁)にPPH申請する例



(事例2) A庁、B庁ともに第一庁ではない例



#### IV. 「特許審査ハイウェイ」の世界的な拡大に向けて

本「PPH MOTTAINAI」試行プログラムを通じて、より多くの出願がPPH申請の対象となり、我が国出願人がより多くの特許を迅速に取得できるようになると期待されます。

今後も我が国は、出願人が海外において安定的な権利を迅速に取得することを支援すべく、更なるPPHのネットワーク拡大を目指し、各国と交渉を行ってまいります。また、各国におけるPPH申請の要件及び手続の共通化等を通じて、本取組の利便性向上につとめてまいります。

(リンク)

PPH MOTTAINAIに関する特許庁HP  
<http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/mottainai.htm>

# 産業財産権の現状と課題の公表について ～グローバル化に対応した知的財産システムの強化～ ＜特許行政年次報告書 2011 年版＞

企画調査課

## I. はじめに

この度、産業財産権をめぐる政策の現状と方向性、国内外の動向と分析及び統計情報等を取りまとめた特許行政年次報告書を公表いたしました。本報告書が、産業財産権行政の現状と課題への理解を深め、産業財産権制度の更なる発展のための一助となることを期待しています。

本稿では、特許行政年次報告書 2011 年版の概要を紹介します。

### 2011 年版のポイント

1. 2010 年の特許出願件数は、前年とほぼ同様となりました。この背景には、昨今の景気の影響とともに、出願人が特許出願の厳選を行い、事業展開の核となる質の高い出願を目指す特許出願戦略を採用してきていることが考えられます。
2. 我が国の PCT 出願件数を見ると、2010 年は、2009 年に比べ増加しました。これは、日本企業の活動が一層グローバル化したこと及び知的財産権保護の重要性について認識が高まってきたことが背景にあるといえます。
3. 意匠登録出願件数、商標登録出願件数は、2010 年に増加に転じました。
4. 我が国は特許審査ハイウェイ（PPH）の対象国拡大を積極的に進めています。

## II. 概要

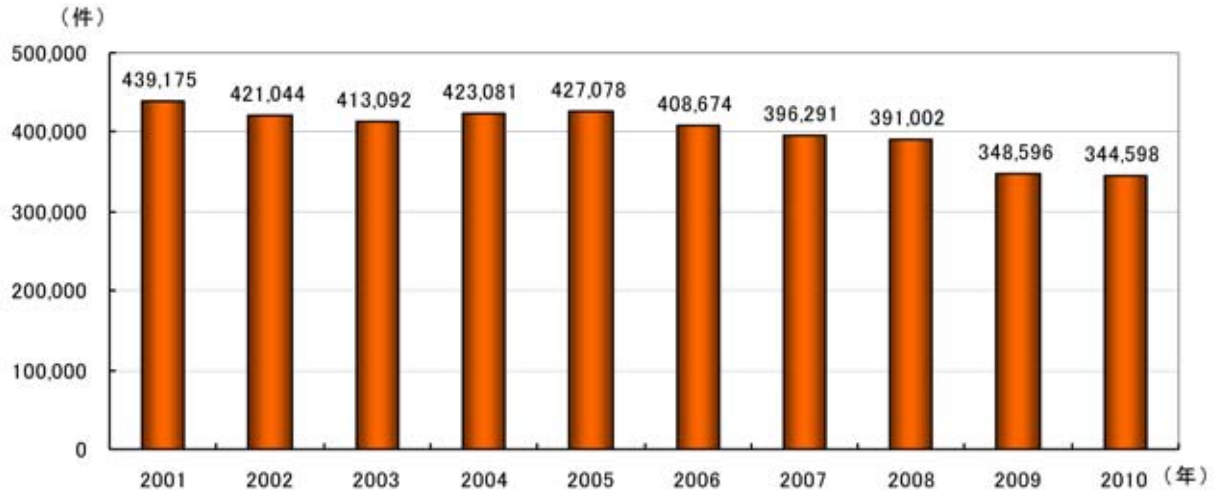
### 1. 産業財産権をめぐる動向

#### (1) 国内外の出願・登録状況と審査・審判の現状

##### ①特許

2010 年の特許出願件数は、前年とほぼ同様の 344,598 件（前年比 1.1% 減）となりました。この背景には、昨今の景気の影響とともに、出願人が特許出願の厳選を行い、事業展開の核となる質の高い特許出願を目指す戦略を採用してきていることが考えられます。

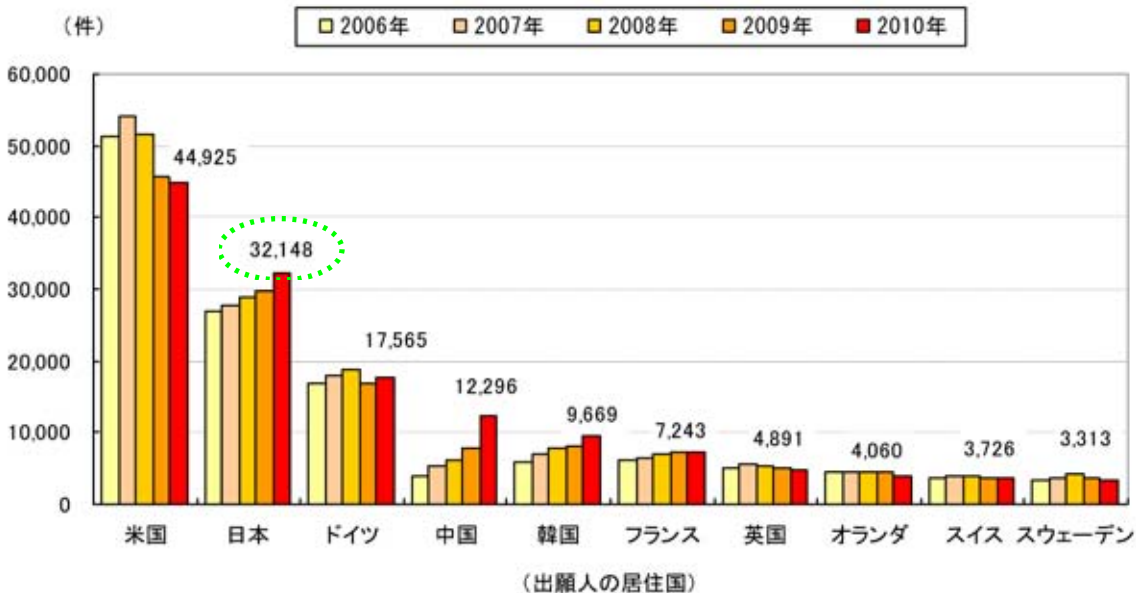
## 【特許出願件数の推移】



我が国の PCT 出願（特許協力条約に基づく国際出願）件数を見ると、2010 年は 32,148 件（前年比 7.9% 増）であり、2003 年以降、米国に次ぐ世界第 2 位を維持しています。これは、日本企業の活動が一層グローバル化したこと及び国際的な知的財産権保護の重要性について認識が高まってきたことが背景にあるといえます。

中国の 2010 年の PCT 出願件数は、12,296 件（前年比 56% 増）であり、2009 年にフランスを抜いたのに続き、2010 年は韓国を抜いて、世界第 4 位となりました。

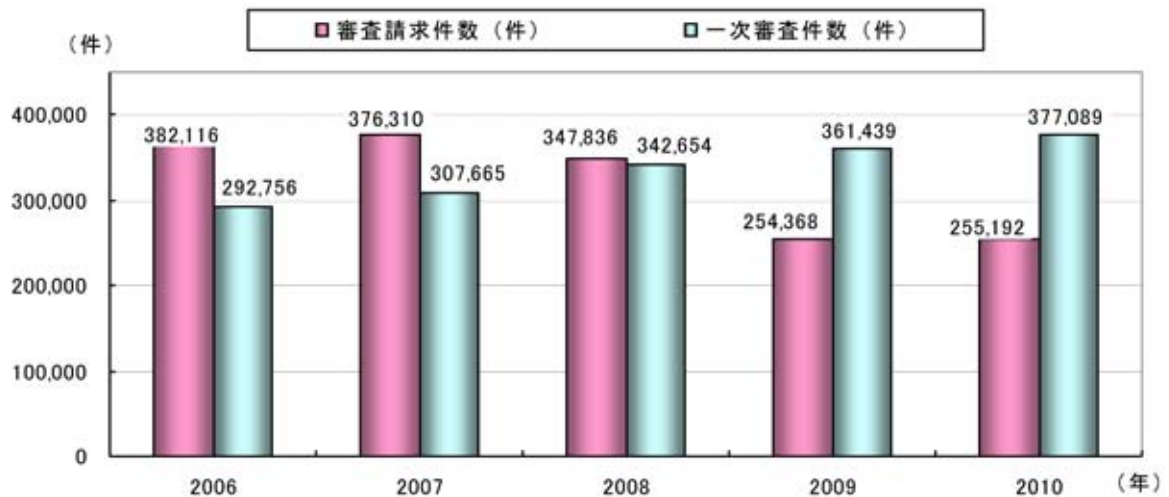
## 【出願人の居住国別の PCT 出願件数の推移】



2010年の審査請求件数は、2009年とほぼ同様の255,192件（前年比0.3%増）となりました。

一次審査<sup>1</sup>件数は、2009年に引き続き、審査請求件数を上回りました。その結果、審査順番待ち件数は2010年末の時点で57.3万件（前年比20%減）に減少し、また、2009年まで長期化の傾向を示してきた審査順番待ち期間<sup>2</sup>は、2010年には短縮に転じ、28.7か月となりました。

### 【審査請求件数と一次審査件数の推移】



### 【審査順番待ち件数と審査順番待ち期間の推移】



1 出願人により審査請求がなされた後に、最初に行われる審査

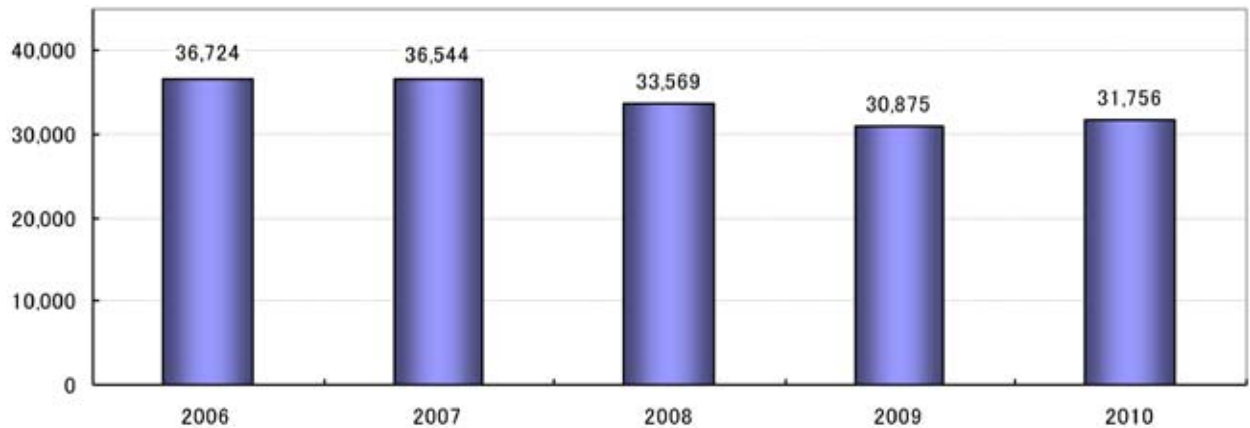
2 審査請求から一次審査までの期間

## ②意匠・商標

意匠登録出願件数は近年、減少傾向が続いていましたが、2010年は増加に転じ、31,756件（前年比2.9%増）となりました。

商標登録出願件数は113,519件（前年比2.4%増）となりました。そのうち、国際商標登録出願<sup>1</sup>については10,825件（前年比1.7%増）となりました。

### 【意匠登録出願件数の推移】



### 【商標登録出願件数の推移】



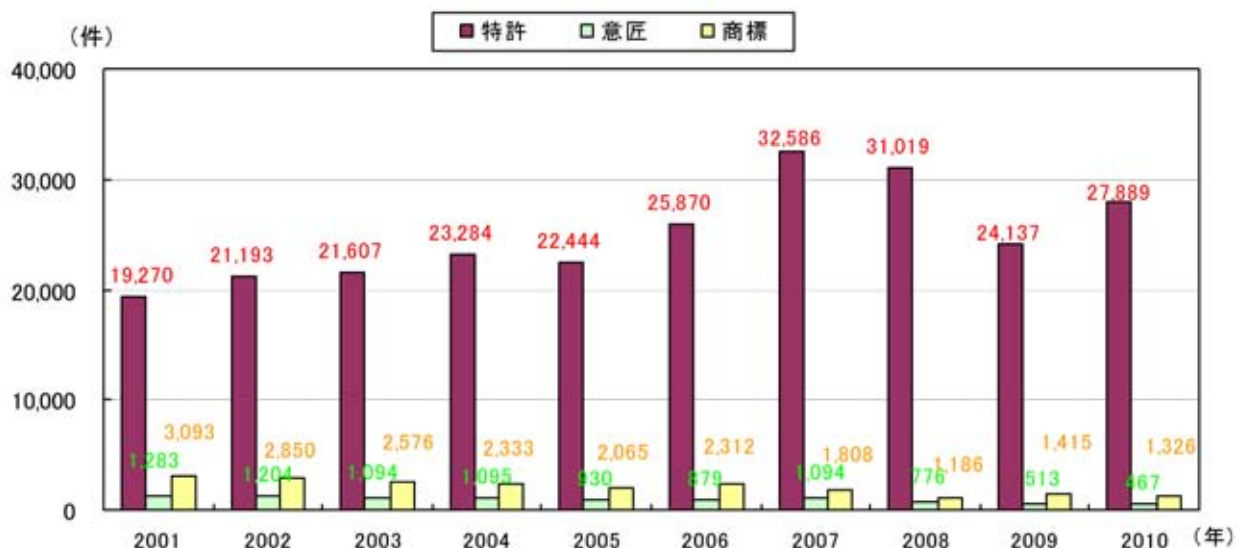
1 マドリッド協定議定書に基づく国際出願であって、日本国特許庁を指定したもの

### ③審判

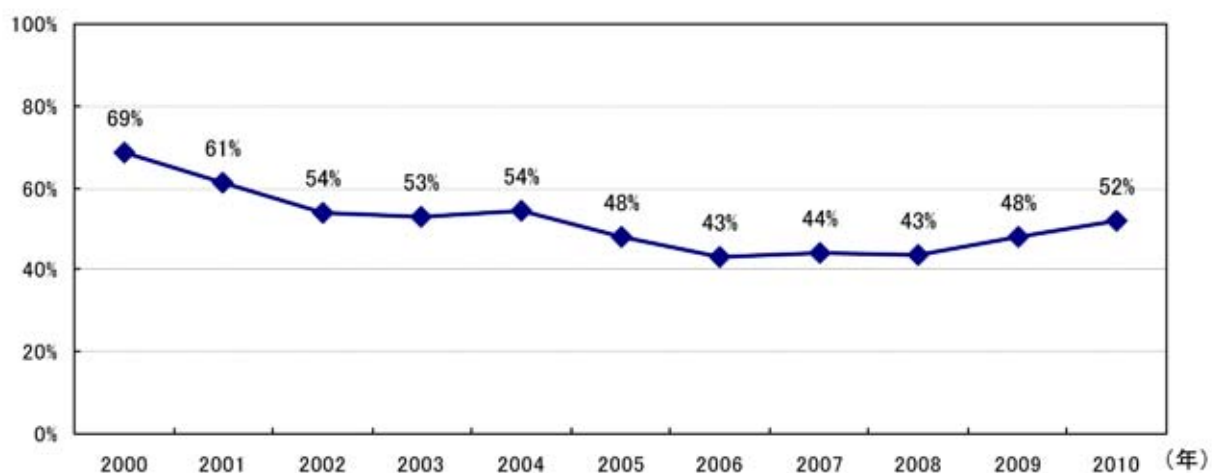
特許の拒絶査定不服審判の請求件数は、2009年に一時的に大幅に減少しましたが、2010年には27,889件（前年比16%増）となりました。

特許の拒絶査定不服審判において、2010年の請求成立率<sup>1</sup>は52%となりました。

#### 【拒絶査定不服審判請求件数の推移】



#### 【拒絶査定不服審判事件における請求成立率の推移（特許）】



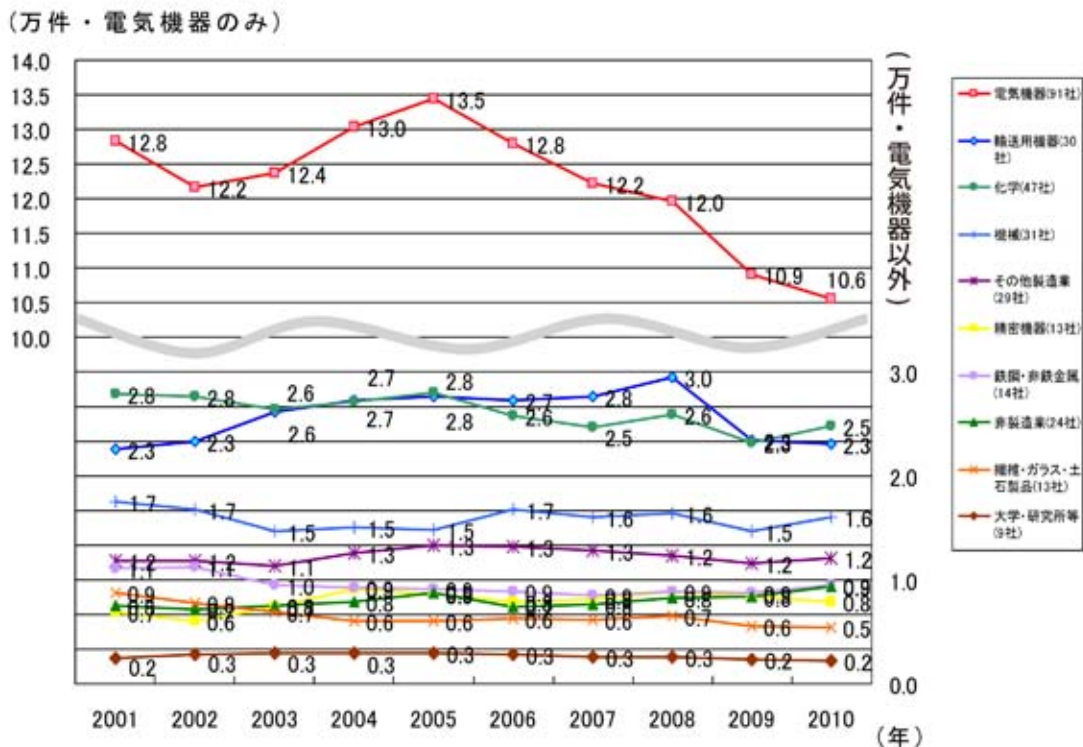
1 審判により審決がなされたもののうち、請求が成立するとされた（すなわち、特許査定となった）審決の割合

(2) 我が国における知的財産活動の実態

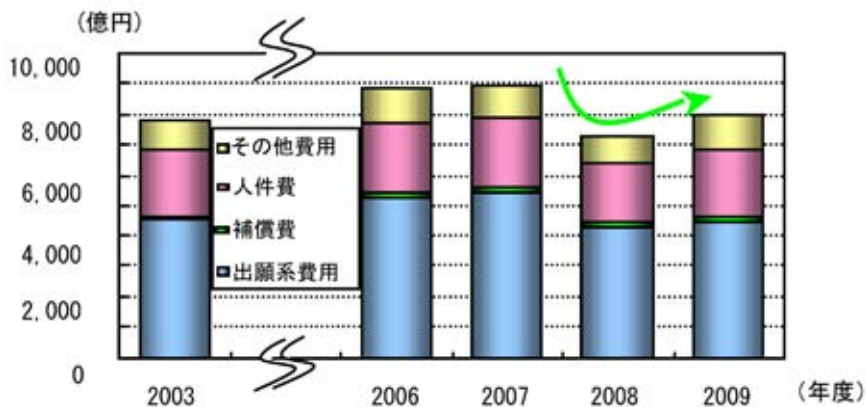
2010年の特許出願件数を業種別に見ると、電気機器では継続して減少傾向となりました（前年比3.1%（3千件）減）。他方、化学（同6.5%（1.5千件）増）、機械（同9.3%（1.4千件）増）など、増加に転じた業種も見られました。

2010年度の特許庁調査によれば、我が国企業等の知的財産活動費は、2008年度に大きく減少しましたが、足下では回復の兆しが見られました。

【業種別特許出願件数の推移（2010年出願件数上位301社）】



【知的財産活動費の推移（全体推計値）】

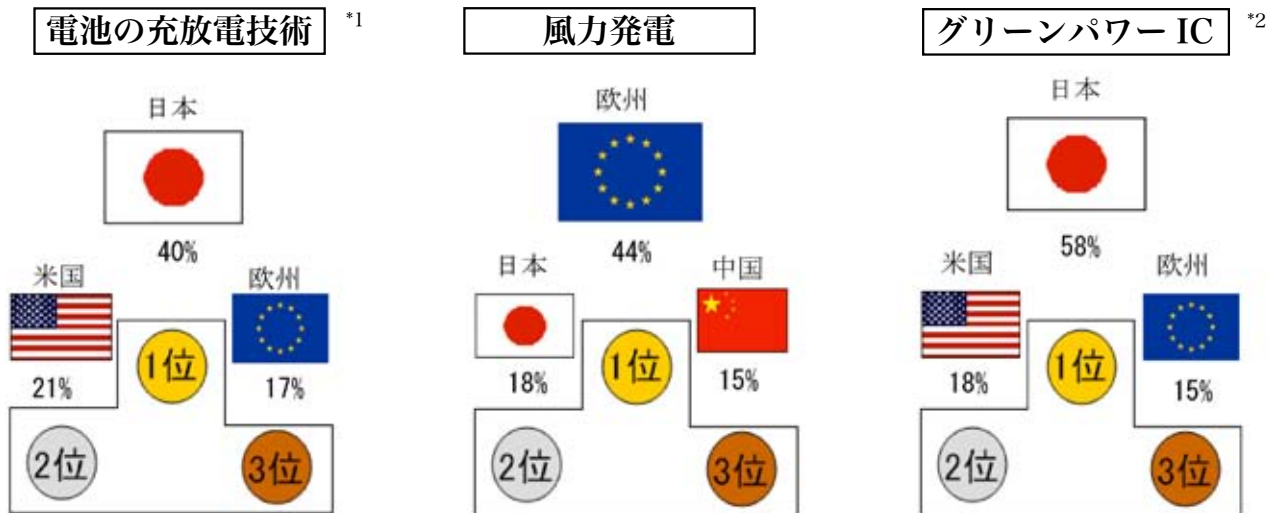


(3) 各分野における知的財産活動の実態

2010年度は、環境・エネルギー分野、ライフサイエンス分野を中心に12の技術テーマについて、特許出願の傾向から見た技術動向調査を行いました。

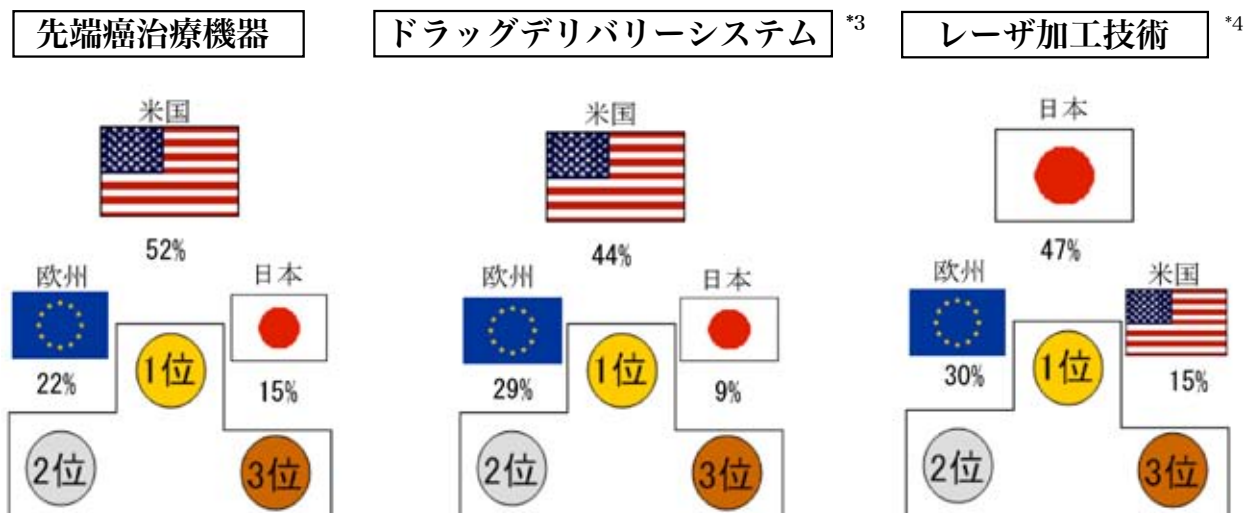
各技術テーマで、どの国が強いのか、どの企業が強いのか等についての調査をし、今後日本が進むべき方向性について分析を行いました。

**【出願人国籍別の日米欧中韓への出願割合】**



\*1 充電式電池の持つ性能を最大限活用しながら、劣化の抑制、安全の確保を図る技術

\*2 電力変換時のエネルギーロスの小さい電力用半導体素子



\*3 治療が必要な疾患部に、薬物を効果的かつ集中的に送り込む技術

\*4 レーザビームを利用した形状の変化を伴う加工技術

## 2. 知的財産活動に対する政府の取組

### (1) 特許における取組

#### ① 先行技術文献調査外注の拡充

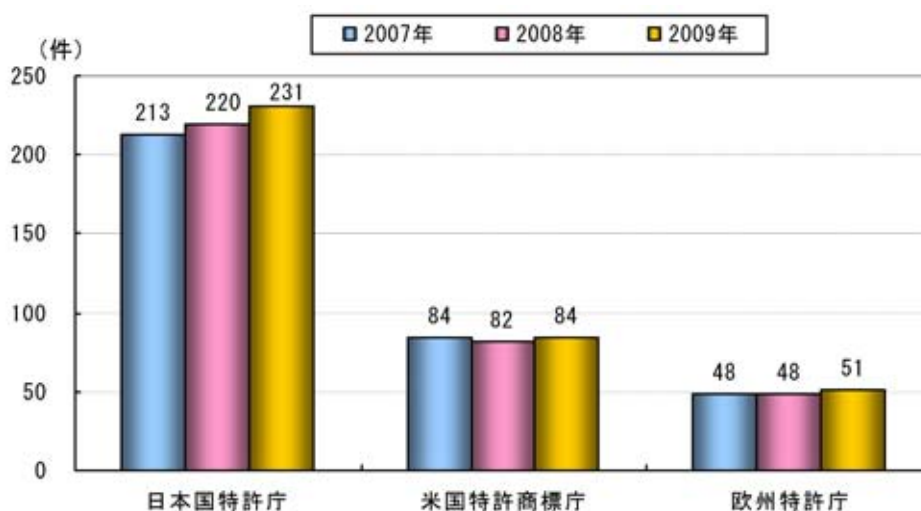
2010年度の先行技術文献調査の外注件数は、24.6万件（前年度比5.6%増）となり、うち、審査効率が高い対話型外注件数は外注件数全体の84.6%（20.8万件）となるなど、一層の民間活力の利用を図りました。

ペーパーレスシステムの構築、先行技術文献調査の外注等により、我が国は米国と比較して2.8倍、欧州との比較では4.5倍の高い効率で、審査を行っています。

【検索外注件数の推移】



【一審査官当たりの審査処理件数】

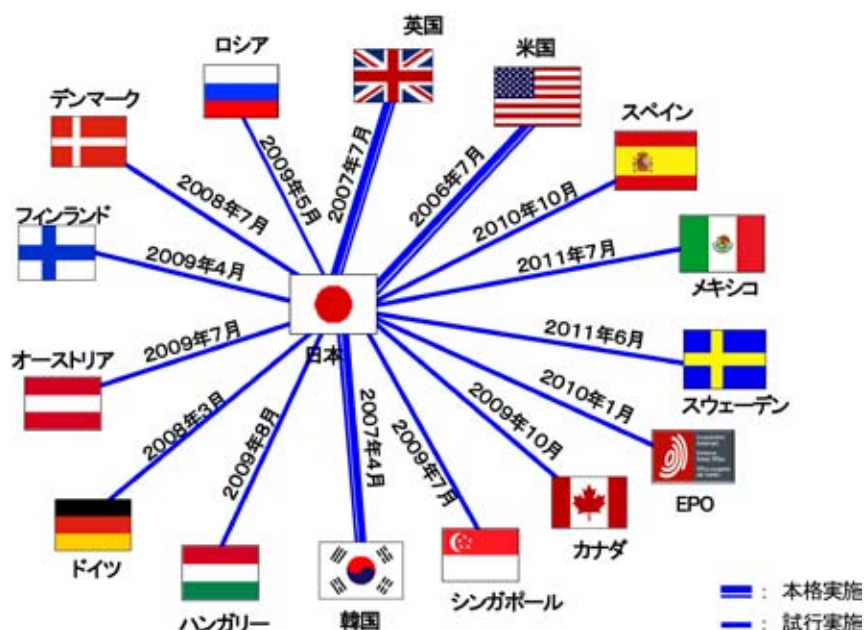


## ②特許審査に関する国際協力の推進

2011年7月1日現在、日本は15の国・地域と、特許審査ハイウェイ<sup>1</sup>を通じて、国際的なワークシェアリングに取り組んでいます。

特に利用件数の多い、日米及び日韓の特許審査ハイウェイでは、2010年12月末までの累計で、日→米への申請が3,119件、米→日への申請が1,014件、日→韓への申請が627件、韓→日への申請が113件となりました。

### 【日本と他国間の特許審査ハイウェイのネットワーク】



## (2) その他の取組

「特許法等の一部を改正する法律案」が、2011年3月11日に閣議決定された後、4月1日に第177回通常国会に提出されました。同法律案は、その後審議を経て可決・成立した後、6月8日に公布されました。

### 【法改正による特許料の減免制度の拡充】

対象者	減免期間
資力に乏しい個人・法人	対象拡大
研究開発型中小企業	1-3年目 → 1-10年目
大学・独法等	

### 【法改正による意匠登録料の引下げ】

登録料	1-3年目	4-10年目	11-20年目
	毎年 8,500円	毎年 16,900円	毎年 33,800円 → 16,900円

1 ある国で特許権を取得することが可能と判断された出願について、出願人の申請により、別の国で簡易な手続で審査を早期に受けられるようにする制度

特許庁では、東日本大震災により影響を受けた方々に対し、手続期間の延長等の救済措置を講じるとともに、相談体制の充実や特許庁ホームページ等による情報提供を行っています。6月27日現在で46か国・地域の知的財産庁（米国、欧州、中国、韓国等）が特例措置を発表しています。

### 【東日本大震災に関する手続相談窓口】

電話：代表 03-3581-1101	
◇出願手続に関すること 特許庁審査業務部方式審査課	内線 5000
◇国際出願（PCT）及び商標の 国際出願（マドリッド協定議定書）手続に関すること 特許庁審査業務部国際出願課	内線 5100
◇登録手続に関すること 特許庁審査業務部出願支援課登録室	内線 5200
◇審判手続に関すること 特許庁審判部審判課	内線 5300
◇その他の手続に関すること 特許庁審査業務部方式審査課方式審査基準室	内線 2113

\*特許行政年次報告書は、特許庁ホームページにおいても公表しています。

<http://www.jpo.go.jp/index/insatsubutsu.html>

にて、過去の年次報告書とともに公表していますので、ご活用下さい。

# WIPOにおける意匠制度の 手続調和に向けた動きについて

意匠課

## 1. はじめに

現在、WIPO（世界知的所有権機関）のSCT会合において検討が進められている意匠制度の手続調和に向けた動きについて、これまでの経緯と現在の議論の方向性をご紹介します。

## 2. SCT会合とは

SCT会合は、商標・意匠・地理的表示の法律について討議、検討を行うWIPOの常設委員会（Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications）であり、1998年からほぼ年2回（春・秋）、スイス・ジュネーブのWIPOにおいて開催されています。意匠に関しては、2006年11月に開催された第16回会合から、意匠登録の手続の調和に関する議論が開始されました。SCTでの議論には、約80の国及び地域の知的財産庁、代理人団体等から専門家が参加しており、総勢200人を超す参加者が一堂に会し、活発な議論を行っています。

## 3. これまでの経緯

SCT会合における意匠の議論は、各国の意匠制度が大きく異なることから生じる出願人の手続負担を減らすことができるよう、意匠登録の手続の調和を目指し、行われています。議論は、各国が自国の意匠制度を紹介することから始まり、その後、どのようなテーマについて調和を図ることができるかという点について、議論が進められています。2007年11月に行われた第18回会合では、それまでの議論をまとめるため、意匠制度に関するテーマ別のアンケート<sup>1</sup>が行われ、その後、2010年7月に行われた第23回会合までの議論で、手続の調和に関するテーマの絞り込みと、絞り込まれたテーマに対する三段階のレベル分け、すなわち、「収束可能な分野」、「共通する動向が認められる分野」、「現時点で共通する動向が認められない分野」のレベル分けが行われました。

2010年11月の第24回会合においては、このレベル分けされたテーマをもとに作成された「意匠法及び実務－規定草案<sup>2</sup>」がWIPO国際事務局（以下、国際事務局）から初めて提示され、2011年3月の第25回会合からは、条文案形式に編集し直された規定草案をもとに、具体的な内容についての検討が開始されています。

1 WIPO, November 2007, 18th meeting documents, “Questionnaire on Industrial Design Law and Practice (Part I)&(PartII)” [http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=13322](http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=13322)

2 WIPO, November 2010, 24th meeting documents (24/3), “Industrial Design Law and Practice-Draft Provisions” [http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=19689](http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19689)

#### 4. 第 25 回会合における検討

第 25 回会合では、以下に示す条文案及び規則案の二層形式による規定草案<sup>3</sup>に基づいて、議論が行われました。

##### 意匠法及び実務 — 規定草案（仮訳）

条文案		規則案	
第1条	定義	第 1 規則	願書に関する細則
第2条	この条文案及び規則案が適用される出願及び意匠	第 2 規則	意匠の表現に関する細則
第3条	願書	第 3 規則	出願日に関する細則
第4条	出願日	第 4 規則	公開に関する細則
第5条	意匠を開示した場合のグレースピリオド	第 5 規則	代理に関する細則；送達のための住所又は書類送付先住所
第6条	創作者名で出願を行うための要件	第 6 規則	提出物に関する細則
第7条	出願の分割	第 7 規則	更新に関する細則
第8条	意匠の公開	第 8 規則	期限の救済に関する細則
第9条	代理；送達のための住所又は書類送付先住所	第 9 規則	第 13 条に基づく相当な注意が払われたこと又は故意ではないことが官庁によって認定された後の権利の回復に関する細則
第10条	提出物	第 10 規則	実施権若しくは担保権の記録、又は実施権若しくは担保権の記録の訂正又は取消請求の要件に関する細則
第11条	更新	第 11 規則	所有権変更の記録の請求に関する細則
第12条	期限の救済		
第13条	相当な注意が払われたこと又は故意ではないことが官庁によって認定された後の権利の回復		
第14条	実施権又は担保権の記録の請求		
第15条	実施権又は担保権の記録の訂正又は取消請求		
第16条	実施権の記録がない場合の影響		
第17条	実施権の表示		
第18条	所有権変更の記録の請求		
第19条	規則		

この規定草案についての議論は、各国が条文ごとに意見を述べる形で行われ、特に願書の記載項目に関する第 3 条や出願日の認定要件に関する第 4 条、グレースピリオドに関する第 5 条及び更新に関する第 11 条は、各国から多くの意見が出されました。これらの項目について、以下、議論の内容を簡単にご紹介します。

3 WIPO, March 2011, 25th meeting documents (25/2), “Industrial Design Law and Practice-Draft Provisions” [http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=22165](http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22165)

### (1) 願書の記載項目 (第3条、第1規則、第2規則)

条文案第3条及び第1規則、第2規則には、締約国が意匠登録出願の願書に記載を求めることができる項目が規定されています。これらの規定に関しては、対象範囲の明確化や、項目の追加、削除等について各国から意見が出されました。

我が国からは、各国・地域が国内法で規定する特殊な出願、例えば、特許出願から意匠登録出願への変更出願、補正却下後の新出願等、特に原出願の出願日への遡及効を伴う出願がこの規定の対象となるかどうかを明確にするよう求めるとともに、対象となる場合には、出願人の利益のために、願書に所要の記載を求めることができるようにすべきとの意見を述べました。

また、米国からは、新規性の宣言に関する記載項目について、全ての出願人が常に十分な先行調査を行うことができるわけではないため、この項目を削除すべきとの意見が出されました。また、AIPLA (米国知的所有権法協会) からも、意匠は文字ではなく図によって表現されるべきとして、同様にこの項目の削除について意見が出されました。スウェーデンからは、保護を求める期間の記載の必要性が主張されました。

### (2) 出願日の認定 (第4条、第3規則)

条文案第4条及び第3規則には、出願日認定要件が規定されています。出願日は、新規性や先後願等の判断の基点となる重要な日であるため、この出願日認定要件については各国から意見が出されました。

我が国からは、現行の条文案では出願当初に意匠図面の添付がなくても加盟国が出願日を認定できる余地があり、後出しにより第三者が不利益を被るおそれがあるため、図面を出願日認定の必須項目とすべきとの主張を行いました。この点については、デンマーク、FICPI (国際工業所有権弁護士連合) からも同様の意見が出されました。

また、コロンビア、チリ、キューバ、インド等から、料金の支払いも出願日認定要件に加えるべきとの主張がなされましたが、スイスからはこれを支持しない旨の意見が出されました。

### (3) グレースピリオドの適用期間 (第5条)

条文案第5条には、新規性喪失の例外が適用されるグレースピリオドの期間が優先日前12月と規定されており、この点について各国から様々な意見が出されました。

我が国、インド、韓国、中国、ブラジル、サウジアラビア等、国内法における現行のグレースピリオドの期間は6月であると発言する国がある一方で、GRUR (ドイツ産業財産及び著作権保護協会) 等からは12月を支持する旨の意見が出されました。これを受けて韓国からは、ユーザーの要望に合わせ12月に制度改正することも可能である旨の発言がなされました。

グレースピリオドの適用期間については、現時点ではまだ6月又は12月のいずれとするか議論が収束しておらず、今後も適切な期間について継続して検討を行うこととなりました。

#### (4) 更新 (第 11 条、第 7 規則)

条文案第 11 条及び第 7 規則には、保護期間の更新に関する事項が規定されています。現行の条文案では、5 年ごとに更新手続を行う更新制が想定されているため、我が国からは、権利者がより柔軟に保護期間を選べるよう、我が国のように一年ごとの年金制度を採用する国が、納付年分の適正な表示を要件として、複数年分の登録料を一括して支払うことを許容すべき旨の主張を行い、デンマークからの支持を受けました。

その他の条文案に対しても、各国から様々な意見が出され、活発な議論が行われました。

議長からは、今回の議論において各国から出された意見を集約し、国際事務局内で検討の上、修正した条文案を次回会合までに提示することで回答としたい、また、修正条文案を作成するに当たっては、各国から出された意見を可能な限り勘案し、制度ユーザーの利便性を追求しながら、条文に反映させていく旨の発言がなされました。したがって、次回以降も、国際事務局が作成する修正条文案及び規則案に対する検討を継続して行うこととなっています。



SCT 会合に参加する日本代表



会合風景

## 5. おわりに

上記のとおり、現在 WIPO の SCT 会合において、意匠の手続調和に関する議論が活発化しています。検討の土台となっている条文案形式での規定草案には、技術的な修正や補足説明など、具体的に確認すべき事項がまだ多く残されていますが、産業財産権分野における国際的な手続調和の先例である特許法条約やシンガポール条約との整合性を踏まえつつ、意匠分野における手続調和のあるべき姿を追い求めながら、今後も引き続き積極的に議論に参加していきたいと考えております。制度利用者の皆さまからも、引き続き、積極的なご支援、ご協力をよろしくお願い致します。

# 特許庁ニュース

## 「夏休み子ども見学デー」の開催について

8月17日・18日に霞が関の府省庁を中心に「夏休み子ども見学デー」を開催いたします。

「夏休み子ども見学デー」は、子どもたちが親の職場を見学すること等を通して、親子のふれあいを深め、広く社会を知る機会とするために毎年開催しています。

特許庁では『アイデアも財産だ！身近な発明やデザイン、商標に触れてみよう！』をテーマに様々なプログラムを用意しておりますので、夏休みの思い出にぜひご来庁ください。



### ～当日の入館方法～

特許庁正面玄関から入館してください。

(他の入口からは入れません。)

正面玄関で「子ども見学デーに参加するために来た」と警備員にお伝えください。

「子ども見学デー受付」へご案内します。

受付では参加者のお名前を記載していただきますので、ご協力の程お願いいたします。

受付終了後、見学となります。(サイエンスショーの見学については事前申込が必要となりますので、事前申込をお願いします。)

### ～開催概要～

受付時間：8月17日(水)・18日(木) 10時00分～15時30分

プログラム：『アイデアも財産だ！身近な発明やデザイン、商標に触れてみよう！』

1. お留守番ロボットを動かそう
2. 身近な発明やデザインなどの製品に触れよう
3. 環境・エネルギーに優しいソーラーカーを見よう
4. 身近な商標(ブランド)の調査体験コーナー
5. アニメでわかる発明・商標に関するビデオ上映会
6. 発明を楽しむサイエンスショー

(事前申込制、定員40名)

1回目：10時15分～11時00分、

2回目：13時30分～14時15分

※サイエンスショー申込みフォーム



お留守番ロボット

### ～お願い～

当日は節電のため、冷房温度設定(28℃)となっております。熱中症対策のため、水分補給を行うなどの工夫をお願いします。

# 産業財産権関連イベントカレンダー

## その他 平成23年度知的財産権制度説明会(初心者向け)

全国各地で開催いたします。

各開催概要、お申込み要領につきましては、ウェブサイトをご覧ください。

<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/ibento/ibento2/beginner.htm>